



华仪行（北京）科技有限公司  
CIF International Group Co., Ltd.



## CIF 半导体领域仪器设备



**关于 CIF**

CIF 是一家从事仪器设备研发、制造、销售、服务、产品应用为一体的专业化公司, 在微电子、半导体领域, 基于等离子体技术, 为客户提供先进的、高品质的清洗、去胶、涂层、显影、刻蚀等方面仪器装备和应用工艺解决方案。

CIF 中国总部坐落于北京国际企业孵化中心 (IBI), 系国家级高新技术企业, 企业通过 GB/T19001- 2016 /ISO9001-2015 质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证, 全系列产品通过 CE 认证, 并获得多项专利。

**CIF-- 企业精神**

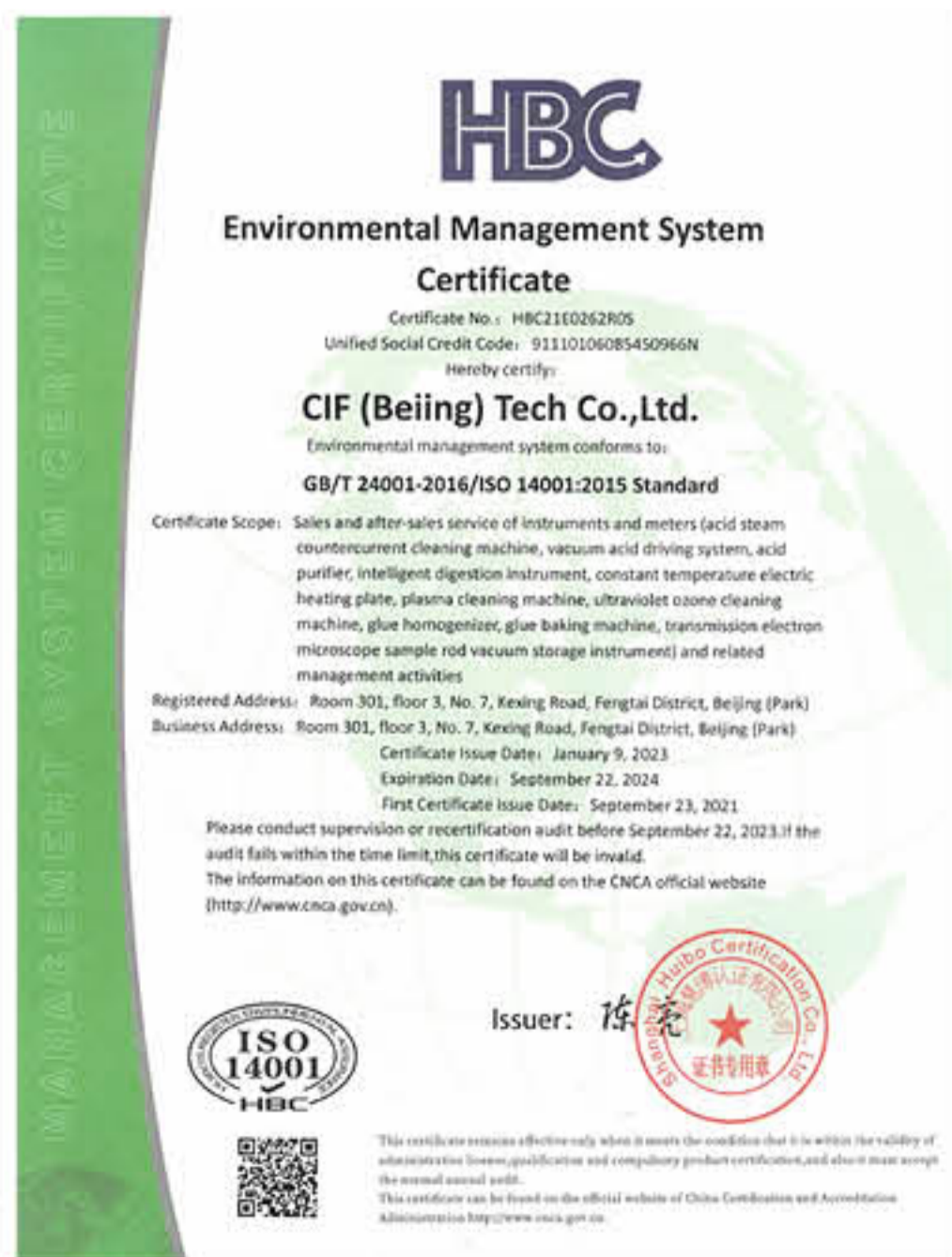
诚信、务实、协作、共赢

**CIF-- 核心理念**

共同成长、成就梦想

**CIF-- 企业愿景**

通过不断地科技创新与发展, 为包括我们的股东、员工、客户乃至商业伙伴在内的所有人, 提供创造和实现他们美好梦想的机会!



# 目录

---

CIF 实验室型等离子清洗机 .....	03
CIF 生产型等离子清洗机 .....	05
RIE 反应离子刻蚀机 .....	06
CIF 等离子去胶机 .....	07
CIF 粉体等离子清洗机.....	08
CIF 手套箱专用等离子清洗机 .....	09
CIF 透射电镜样品杆清洗机.....	10
CIF 扫描电镜等离子清洗机 .....	11
CIF 透射电镜样品杆存储仪 .....	12
CIF 紫外臭氧清洗机 .....	13
CIF 紫外臭氧中和器 .....	14
CIF 匀胶机 .....	15
CIF 烤胶机 .....	16

## CIF 实验室型等离子清洗机

等离子清洗设备在材料学,光学,电子学,医药学,环境学、生物学等科研领域,主要用于材料表面进行清洗、活化、改性等目的。

CIF 推出的新一代等离子体清洗设备,合理的结构设计,优化的腔体尺寸,使得处理样品更大,适用范围更广,性能更稳定,操作更简便,性价比更高,使用成本更低,实用性更强,更容易维护。

### ● 产品特点



- ◆ 7寸彩色触摸屏互动操作界面,图形化用户操作界面显示,自动监测工艺参数状态,20个配方程式,可存储、输出、追溯工艺数据,机器运行、停止提示。
- ◆ PLC 工控机控制整个清洗过程,手动、自动两种工作模式。
- ◆ 采用美国德威尔 (Dwyer) 气体浮子流量计,可输入氧气、氩气、氮气、氢气或混合气等气体,气体分配均匀,经济实用。
- ◆ HEPA 高效过滤,气体返填吹扫,防止二次污染。
- ◆ 316 不锈钢、石英真空仓可选择,全真空管路系统采用 316 不锈钢材质,耐腐蚀无污染。
- ◆ 采用 60 度倾角操作面板设计,符合人体功能学,操作方便,界面友好。
- ◆ 上控制下舱体结构设计,结构紧凑,占地空间小。
- ◆ 内凹式前面板设计,有效保护流量计和舱门运输过程中不易损坏。
- ◆ 处理快速高效均匀,无污染,工艺重复性好。
- ◆ 样品处理温度低,无热损伤和热氧化。
- ◆ 安全保护,仓门打开,自动关闭电源。

### ● 技术参数

型号	CPC-F	CPC-Fplus	ICP3	ICP3 plus
舱体尺寸	D200xΦ155mm	D200xΦ155mm	H120xΦ270mm	H120xΦ270mm
舱体容积	3.8L	3.8L	3.8L	3.8L
射频电源	40KHz	13.56MHz	40KHz	13.56MHz
匹配器	自动匹配	自动匹配	自动匹配	自动匹配
激发方式	电容式	电容式	电感耦合	电感耦合
射频功率	10-300W 可调	10-150W 可调	10-300W 可调	10-150W 可调
气体控制	双浮子流量计			
有效处理尺寸	L200xW155mm			
产品尺寸	L425xW420xH465mm			
包装尺寸	L560xW545xH730mm			
时间设定	1-99 分 59 秒			
真空泵	抽速 4-8m <sup>3</sup> /h			
气体稳定时间	1 分钟			
真空度	100pa 以内			
电源	AC220V 50-60Hz			

## CIF 实验室型等离子清洗机

CIF 推出全新一代实验室型等离子体清洗设备，颠覆传统等离子体清洗设备设计理念，可中试生产、模拟生产条件，几乎具备等离子体清洗设备所有的功能。采用顶置真空仓，上开盖下压式铰链开关方式，上置式 360 度自由取放样品托盘设计，具有较大的腔体尺寸和有效样品处理面积，使用成本低，性价比高，处理快速高效，特别适合于大学，科研院所和光电企业实验室小批量中试生产。

### ● 产品特点

- ◆ 7 寸彩色触摸屏互动操作界面，图形化用户操作界面显示，自动监测工艺参数状态，20 个配方程式，可存储、输出、追溯工艺数据，机器运行、停止提示。
- ◆ PLC 工控机控制整个清洗过程，手动、自动两种工作模式。
- ◆ 石英真空仓，真空管路系统采用 316 不锈钢材质，耐腐蚀无污染。
- ◆ 采用质量流量计实现对气体输入精准控制，改变传统浮子流量计控制气体流量不准确问题。
- ◆ HEPA 高效过滤，气体返填吹扫，防止二次污染。
- ◆ 60 度倾角操作界面设计，符合人体功能学，操作方便，界面友好。
- ◆ 顶置真空仓，上开盖设计，下压式铰链开关方式，开关盖方便。
- ◆ 采用花洒式多孔进气方式，改变传统等离子清洗机单孔进气不均匀问题。
- ◆ 上置式 360 度自由水平取放样品托盘设计，符合人体功能学，操作更方便。
- ◆ 有效清洗面积大，可清洗最大直径 8 寸硅片。
- ◆ 可处理不同几何形状、表面不同粗糙程度的金属、陶瓷、玻璃、硅片、塑料等样品，进行清洗和改性。
- ◆ 安全保护，仓门打开，自动关闭电源。



### ● 技术参数

型号	CPC-G	CPC-G plus	CPC-12	CPC-12plus
舱体尺寸	H120xΦ270mm	H120xΦ270mm	H120xΦ370mm	H120xΦ370mm
舱体容积	6.8L	6.8L	12.8L	12.8L
射频电源	40KHz	13.56MHz	40KHz	13.56MHz
匹配器	自动匹配	自动匹配	自动匹配	自动匹配
激发方式	电容式	电容式	电容式	电容式
射频功率	10-300W 可调	10-150W 可调	10-600W 可调	10-300W 可调
最大处理尺寸	Φ270mm 圆盘		Φ370mm 圆盘	
产品尺寸	L525xW425xH345mm		L618xW520xH465mm	
包装尺寸	L645xW540xH560mm		L750xW640xH570mm	
气体控制	质量流量计 (MFC) (标配单路, 可选双路)			
时间设定	1-99 分 59 秒			
真空泵	抽速 4-8m <sup>3</sup> /h			
气体稳定时间	1 分钟			
真空度	100pa 以内			
电源	AC220V 50-60Hz			

## CIF 生产型等离子清洗机

CIF推出的CPC系列生产型等离子清洗机是为研发型客户和工业级客户而设计的等离子体表面处理设备,配置丰富,且真空腔体里可分层,适合大多数生产场景。适用于等离子清洗,活化以及刻蚀等多种应用,设备可在严苛环境下稳定运行,产品性能稳定,样品处理重复性、一致性好。

### ● 产品特点

- ◆ 7寸彩色触摸屏互动操作界面,图形化用户操作界面显示,自动监测工艺参数状态,0~99个配程序,可存储、输出、追溯工艺数据,机器运行、停止提示。
- ◆ PLC工控机控制整个清洗过程,手动、自动两种工作模式。
- ◆ 采用质量流量计,气体流量控制更准确。标配双路气体输送系统,可选多气路气体输送系统,气体分配均匀。可输入氧气、氩气、氮气、四氟化碳、氢气或混合气体等气体。
- ◆ 采用花洒式多孔进气方式,改变传统等离子清洗机单孔进气不均匀问题。
- ◆ HEPA高效过滤,气体返填吹扫,防止二次污染。
- ◆ 316不锈钢真空仓,洁净无污染。
- ◆ 全真空管路系统采用316不锈钢材质。
- ◆ 处理高效均匀,效率高,工艺重复性好。
- ◆ 合理的结构设计,设备占用空间小。
- ◆ 可处理各种材质、形状、尺寸样品。
- ◆ 样品处理温度低,无热损伤和热氧化。
- ◆ 使用成本低、耗损小。
- ◆ 产品性能稳定,安装与维护,简便方便。
- ◆ 安全保护,仓门打开,自动关闭电源。



### ● 技术参数

型号	CPC15	CPC35	CPC80	CPC120	CPC150
舱体尺寸	W240xH240xD260mm	W320xH320xD350mm	W420xH400xD500mm	W500xH500xD450mm	W500xH500xD600mm
舱体容积	15L	35L	80L	120L	150L
有效尺寸	W210xD245mm	W300xD335mm	W400xD490mm	W500xD440mm	W500xD590mm
电极分布	2层	3-4层	6层	8-10层	10-15层
射频电源	13.56MHz, 0-300W	13.56MHz, 0-300W	13.56MHz, 0-600W	13.56MHz, 0-1000W	13.56MHz, 0-1000W
匹配器	自动匹配器				
激发方式	电容式				
电流	1.2A				
时间设定	1-99分59秒				
气体稳定时间	1分钟				
真空度	100pa以内				
控制系统	7寸PLC触摸屏控制				
工艺气体	2气路MFC(可选装3路)				
真空泵	抽速约8m <sup>3</sup> /h	抽速16m <sup>3</sup> /h	抽速40m <sup>3</sup> /h	抽速60m <sup>3</sup> /h	抽速约60m <sup>3</sup> /h
电源	AC220V 50-60Hz	AC220V 50-60Hz	AC380V 50-60Hz	AC380V 50-60Hz	AC380V 50-60Hz

备注:根据用户要求,可选中频电源40KHz,功率300-2000W可选。

## RIE 反应离子刻蚀机

CIF 推出 RIE 反应离子刻蚀机, 采用 RIE 反应离子诱导激发方式, 实现对材料表面各向异性的微结构刻蚀。特别适合于大学, 科研院所、微电子、半导体企业实验室进行介质刻蚀、硅刻蚀、金属刻蚀等方面研究。使用成本低, 性价比高, 易维护, 处理快速高效。适用于所有的基材及复杂的几何构形进行 RIE 反应离子刻蚀。具体包括: ◆介电材料 (SiO<sub>2</sub>、SiN<sub>x</sub> 等) ◆硅基材料 (Si, a-Si, poly Si) ◆III-V 材料 (GaAs、InP、GaN 等) ◆溅射金属 (Au、Pt、Ti、Ta、W 等) ◆类金刚石 (DLC)

### ● 产品特点

- ◆ 7 寸彩色触摸屏互动操作界面, 图形化用户操作界面显示, 自动监测工艺参数状态, 20 个配方程序, 可存储、输出、追溯工艺数据, 机器运行、停止提示。
- ◆ PLC 工控机控制整个清洗过程, 手动、自动两种工作模式。
- ◆ 真空舱体、全真空管路系统采用 316 不锈钢材质, 耐腐蚀无污染。
- ◆ 采用防腐数字流量计, 实现对气体输入精准控制。标配双路气体输送系统, 可选多气路气体输送系统, 气体分配均匀。可输入氧气、氩气、氮气、四氟化碳、氢气或混合气等气体。
- ◆ 采用花洒式多孔进气方式, 改变传统等离子清洗机单孔进气不均匀问题。
- ◆ HEPA 高效过滤, 气体返填吹扫, 防止二次污染。
- ◆ 符合人体功能学的 60 度倾角操作界面设计, 操作方便, 界面友好。
- ◆ 采用顶置真空仓, 上开盖设计, 下压式铰链开关方式。
- ◆ 上置式 360 度水平取放样品设计, 符合人体功能学, 操作更方便。
- ◆ 有效处理面积大, 可处理最大直径 200mm 晶元硅片。
- ◆ 安全保护, 仓门打开, 自动关闭电源。



### ● 技术参数

型号	RIE200	RIE200plus
舱体内尺寸	H38xΦ260mm	H38xΦ260mm
舱体容积	2L	2L
射频电源	40KHz	13.56MHz
电极	不锈钢气浴 RIE 电极, Φ200mm	不锈钢气浴 RIE 电极, Φ200mm
匹配器	自动匹配	自动匹配
刻蚀方式	RIE	RIE
射频功率	10-300W 可调 (可选 10-1000W)	10-300W 可调 (可选 10-600W)
气体控制	质量流量计 (MFC) (标配双路, 可选多路) 流量范围 0-500SCCM (可调)	
工艺气体	Ar、N <sub>2</sub> 、O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> 、CF <sub>4</sub> 、CF <sub>4</sub> +H <sub>2</sub> 、CHF <sub>3</sub> 或其他混合气体等 (可选)	
最大处理尺寸	≤ Φ200mm	
时间设定	1-99 分 59 秒	
真空泵	抽速约 8m <sup>3</sup> /h	
气体稳定时间	1 分钟	
极限真空	≤ 1Pa	
电源	AC220V 50-60Hz, 所有配线符合《低压配电设计规范 GB50054-95》、《低压配电装置及线路设计规范》等国家标准相关规定。	

## CIF 等离子去胶机

CIF 推出等离子去胶机, 采用电感耦合各向同性(各个方向)等离子激发方式, 适用于所有的基材及复杂的几何构形都可以进行等离子体去胶。其外观美学设计, 结构紧凑, 漂亮大气, 优化的腔体结构及合理的结构设计, 使得处理样品量更大, 适用范围更广, 性能更稳定, 操作更简便, 性价比更高, 使用成本更低, 实用性更强, 更容易维护。特别适合于大学, 科研院所和微电子、半导体企业实验室, 对电路板、外延片、芯片、环氧树脂、MEMS 制造过程中牺牲层, 干刻或湿刻处理前或后, 对基材进行聚合物剥离、金属剥离、掩膜材料等光刻胶去除, 以及晶圆表面预处理等。



### ● 产品特点

- ◆ PLC 工控机控制整个去胶过程, 手动、自动两种工作模式。
- ◆ 7 寸彩色触摸屏互动操作界面, 图形化用户操作界面显示, 自动监测工艺参数状态, 20 个配程序, 可存储、输出、追溯工艺数据, 机器运行、停止提示。
- ◆ 石英真空仓, 全真空管路系统采用 316 不锈钢材质, 耐腐蚀无污染。
- ◆ 可选用石英舟, 更适合晶元硅片去胶应用。
- ◆ 有效处理面积大, 可处理最大直径 200mm 晶元硅片。
- ◆ 采用花洒式多孔进气方式, 改变传统等离子清洗机单孔进气不均匀问题。
- ◆ 采用防腐数字流量计, 实现对气体输入精准控制。标配双路气体输送系统, 可选多气路气体输送系统, 气体分配均匀。可输入氧气、氩气、氮气、四氟化碳、氢气或混合气等气体。
- ◆ HEPA 高效过滤, 气体返填吹扫, 防止二次污染。
- ◆ 处理高效均匀, 效率高, 工艺重复性好。
- ◆ 样品处理温度低, 无热损伤和热氧化。
- ◆ 安全保护, 仓门打开, 自动关闭电源。

### ● 技术参数

型号	SPB5	SPB5plus
舱体尺寸	D200xΦ155mm	D200xΦ155mm
舱体容积	3.8L	3.8L
射频电源	40KHz	13.56MHz
匹配器	自动匹配	自动匹配
激发方式	电感耦合	电感耦合
射频功率	10-300W 可调	10-300W 可调 (可选 10-600W)
最大处理尺寸	Φ150m	Φ150m
气体控制	质量流量计 (MFC) (标配单路, 可选双路) 流量范围 0-500SCCM (可调)	
工艺气体	Ar、N <sub>2</sub> 、O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> 、CF <sub>4</sub> 、CF <sub>4</sub> +H <sub>2</sub> 、CHF <sub>3</sub> 或其他混合气体等 (可选)	
时间设定	1-99 分 59 秒	
真空泵	抽速约 8m <sup>3</sup> /h	
气体稳定时间	1 分钟	
极限真空	≤ 1Pa	
电源	AC220V 50-60Hz, 所有配线符合《低压配电设计规范 GB50054-95》、《低压配电装置及线路设计规范》等国标标准相关规定。	

## CIF 粉体等离子清洗机

CIF 专为处理粉体如粉状、颗粒状材料样品而设计的粉体专用等离子清洗机，可以高效率地处理微细的甚至分子级别的超细粉体材料，改变传统真空等离子清洗机无法处理粉体样品的问题。

等离子体作用在粉体上，可以有目的地改变粉体的物理化学性质，在保持粉体原有性能的前提下，赋予其表面新的性能，使其表面性质由疏水性变为亲水性或由亲水性变为疏水性，从而改善粉体粒子表面的浸润性，增强粉体粒子在介质中的界面相容性，使粒子容易分散在水中或有机化合物中。粉体材料表面改性是材料制备、新材料、新工艺和新产品开发的重要方法，提高了粉体材料的附加价值，扩大了粉体材料的应用领域。

### ● 产品特点

- ◆ 7 寸彩色触摸屏互动操作界面，图形化用户操作界面显示，自动监测工艺参数状态，20 个配方程式，可存储、输出、追溯工艺数据，机器运行、停止提示。
- ◆ PLC 工控机控制整个清洗过程，手动、自动两种工作模式。
- ◆ 采用弧形等离子激发板设计，等离子激发能力更强。
- ◆ 采用美国德威尔 (Dwyer) 气体浮子流量计，双路气体控制气体流量，可输入氧气、氩气、氮气、氢气或混合气等气体，气体分配均匀，经济实用。
- ◆ HEPA 高效过滤，气体返填吹扫，防止二次污染。
- ◆ 采用 316 不锈钢真空舱体，洁净无污染。
- ◆ 全真空管路系统采用 316 不锈钢材质。
- ◆ 符合人体功能学的 60 度倾角操作界面设计，操作方便，界面友好。
- ◆ 上控制下舱体结构设计，结构紧凑，占用实验室空间小。
- ◆ 内凹式前面板设计，有效保护流量计和舱门运输过程中不易损坏。
- ◆ 安全保护，仓门打开，自动关闭电源。
- ◆ 动态清洗，清洗完全，无死角，无污染，并且专业、均匀、快速、高效。



### ● 技术参数

型号	CPCP3	CPCP3plus
舱体尺寸	D200XΦ155mm	D200XΦ155mm
舱体容积	3.8L	3.8L
石英转瓶尺寸	Φ75xH120mm	Φ75xH120mm
转瓶转速	1-15rpm/ 秒可调	1-15rpm/ 秒可调
射频电源	40KHz	13.56MHz
匹配器	自动匹配	自动匹配
激发方式	电容式	电容式
射频功率	10-300W 可调	10-150W 可调
气体控制	双浮子流量计	
产品尺寸	L425xW420xH465mm	
时间设定	1-99 分 59 秒	
气体稳定时间	1 分钟	
真空度	100pa 以内	
电源	220V 50/60Hz	

## CIF 手套箱专用等离子清洗机

CIF 推出 VGB-P 系列手套箱专用等离子清洗设备, 优化的腔体结构及合理的结构设计更适合手套箱内使用。安装简单方便, 性能稳定, 实用性强, 容易维护。



### ● 产品特点

- ◆ 7 寸彩色触摸屏互动操作界面, 图形化用户操作界面显示, 自动监测工艺参数状态, 20 个配程序, 可存储、输出、追溯工艺数据, 机器运行、停止提示。
- ◆ PLC 工控机控制整个清洗过程, 手动、自动两种工作模式。
- ◆ 真空仓体, 全真空管路系统采用 316 不锈钢材质, 耐腐蚀无污染。
- ◆ 自动匹配器, 功率无极可调。
- ◆ 采用美国德威尔 (Dwyer) 气体浮子流量计, 双路气体控制气体流量, 可输入氧气、氩气、氮气、氢气或混合气等气体, 气体分配均匀, 经济实用。
- ◆ HEPA 高效过滤, 气体返填吹扫, 防止二次污染。
- ◆ 弧形等离子激发板, 等离子激发能力更强。
- ◆ 分体式设计, 便于手套箱内使用。
- ◆ 安全保护, 仓门打开, 自动关闭电源。

### ● 技术参数

型号	VGB3	VGB3Plus
舱体尺寸	D178xΦ150mm	D178xΦ150mm
舱体容积	3L	3L
射频电源	40KHz	13.56MHz
匹配器	自动匹配	自动匹配
激发方式	电容式	电容式
射频功率	10-300W 可调	10-150W 可调
气体控制	双浮子流量计 (标配)	
有效处理尺寸	L200xW155mm	
时间设定	1-99 分 59 秒	
真空泵	抽速 4-8m <sup>3</sup> /h	
气体稳定时间	1 分钟	
真空度	100pa 以内	
电源	AC220V 50-60Hz	

## CIF 透射电镜样品杆清洗机

CIF 透射电镜 (TEM) 样品杆清洗机采用远程离子清洗源设计, 清洗快速高效, 低轰击损伤, 同时可实现常规等离子清洗。主要用于 TEM 透射电镜样品杆的等离子体清洗和真空检漏。



### ● 产品特点

- ◆ 远程离子清洗源
- ◆ 一机多用
- ◆ 清洗快速高效, 低轰击损伤

### ● 技术参数

产品型号	CIF-TEM
等离子电源	13.56MHz 等离子射频电源, 射频功率 5-120W 可调 远程等离子源, 自动匹配器
清洗室	清洗室尺寸 Ø180xH100mm
清洗数量	可同时清洗 3 支 TEM 样品杆
适配品牌	THERMO FISHER (FEI)、日立 HITACHI、捷欧路 JEOL
气体控制	标配单路质量流量计 (MFC) 可选双路。50 毫升 / 分, 自动控制气体流量, 不会受环境温度和压力变化影响
气源选择	根据需求氧气、氩气、氮气、氢气等多种清洗气源选择
真空控制	质量流量计 (MFC), 皮拉尼真空计, 测量范围 1E-5Torr
真空保证	真空计和电磁阀安全互锁
操控方式	7 寸全彩触摸屏控制, 中英文互动操作界面
真空泵	前级泵
	抽气速率 2 L/s
	分子泵
	极限真空 :CF:5x10-6Pa, ISO-K: 3x10-5Pa
	分子泵抽速 >80L/s (N2)
	入口法兰: DN100CF/DN100 ISO-K
质量保证	二年质保, 终身维护
电 源	220V, 50/60Hz, 300W

## CIF 扫描电镜等离子清洗机

CIF 扫描电镜 (SEM) 等离子清洗机采用远程等离子清洗源设计, 清洗快速、高效、低轰击损伤, 主要用于 SEM 或 FIB 等电镜腔体内碳氢化合物的清洗。

### ● 产品特点

- ◆ 远程等离子清洗源
- ◆ 清洗快速、高效
- ◆ 低轰击损伤



### ● 技术参数

产品型号	CIF-SEM
法兰接口	KF40 (CF40)
工作气压	0.3-3Pa
等离子电源	13.56MHz 射频电源, 射频功率 5-150W 可调, 远程等离子源, 自动匹配器
气体控制	标配单路质量流量计 (MFC) 可选双路。50 毫升 / 分, 自动控制气体流量, 不会受环境温度和压力变化影响
气源选择	根据需求氧气、氩气、氮气、氢气等多种清洗气源选择
真空控制	皮拉尼真空计, 测量范围 1E-5Torr
真空保证	真空计和电磁阀安全互锁
操控方式	7 寸全彩触摸屏控制, 中英文互动操作界面
电源 / 功率	220V, 50/60Hz, 300W
可选配件	可选氧气、氮气、氢气发生器, 氢气纯度 > 99.999%, 输出流量 0-300ml/min
质量保证	二年质保, 终身维护

## CIF 透射电镜样品杆存储仪

CIF 透射电镜 (TEM) 样品杆存储仪采用无油隔膜泵, 通过抽真空产生 100 Pa 恒定洁净无污染的真空环境, 特别适用于 TEM 透射电镜样品杆的日常真空储存或水汽去除, 简单方便实用。

### ● 产品特点

- ◆ 洁净无污染
- ◆ 真空度稳定
- ◆ 方便实用



### ● 技术参数

产品型号	CIF-VS
真空泵	双级无油隔膜真空泵, 抽速 0.7 m <sup>3</sup> /h
气体控制	标配一路清洗气体, 采用质量流量计 (MFC), 自动控制气体流量, 不会受环境温度和压力变化影响, 测量范围 1Pa-100kPa
真空保证	真空计和电磁阀安全互锁, 自动保证恒定真空
存储气压	200Pa
存储数量	5 支样品杆
适配品牌	THERMO FISHER (FEI)、日立 HITACHI、捷欧路 JEOL
操控方式	7 寸全彩触摸屏控制, 中英文互动界面
质量保证	二年质保, 终身维护

## CIF 紫外臭氧清洗机

紫外臭氧清洗机(UVO),是一种简单,经济,快速高效的材料表面清洗设备,能快速去除大多数无机基材(比如石英,硅片,金,镍,铝,砷化镓,氧化铝等)上的有机污染物。

CIF 紫外臭氧清洗机采用长寿命 UV 石英低压汞蒸汽格栅灯,样品台高度可调并可选加热控温,以便达到最佳清洗效果。



### ● 产品特点

- ◆ UVO 基础型采用可编程数字控制器,设置操作简单方便,四键操作控制。UVOP 和 UVOT 系列采用 5 寸彩色触摸屏设置显示计时时间及加热温度。
- ◆ 自动补偿功能,自动恒定光强光密度,不会因为低压汞灯老化光强衰减影响清洗效果。
- ◆ 数字倒计时显示清洗时间,1-999 分钟之间可自行设置清洗时间。
- ◆ 任何时间可以手动中断处理过程。
- ◆ 自动记录之前清洗参数设置。
- ◆ 样品台可控温(可选),控温范围 RT-220°C,控温精度 0.1°C。
- ◆ 顶置下压式铰链开关盖方式,操作简单方便。
- ◆ 上置式样品台设计,360 度自由放置样品,操作方便。
- ◆ 样品台高度可调,通过调节灯与样品之间的间距,可以合理定位样品高度和位置,并可锁定。
- ◆ UV 石英低压汞蒸汽格栅灯,灯管寿命大约为 8000 小时。
- ◆ 高强度 UV 灯源,波长 185nm 和 254nm。
- ◆ 可累计计时 UV 格栅灯使用时长,更换提示。
- ◆ UV 反射罩(长 X 宽)比 UV 格栅灯大 2.5cm,比如规格为 13x13cm 格栅灯反射罩尺寸大于 15x15cm。
- ◆ 双重安全保护,带有安全锁,当清洗腔打开时,系统自动关掉 UV 灯,并有灯光通断提示。
- ◆ 带进 & 出气口双气路设计。
- ◆ 可接入氧气或者臭氧,增加臭氧产量。
- ◆ UVO5 可选外置臭氧中和器,UVO9、UVO12 系列可选外置或者内置臭氧中和器,用于臭氧清除。
- ◆ 可根据客户要求定制铝或石英材料真空反应腔。

### ● 技术参数

产品型号	UV 灯尺寸 cm	样品台高度 cm	主机重量 kg	外型尺寸 (LxWxH) cm
UVO5/UVO5P/UVO5T	13x13	5cm 内可调	6	31x26x20
UVO9/UVO9P/UVO9T	23x23	5cm 内可调	12.5	60x50x20
UVO12/UVO12P/UVO12T	33x33	5cm 内可调	18.5	70x60x20

注:UVO 型基础型样品台不带加热功能,样品台高度可调;UVOP 可选配样品台加热功能,样品台高度可调;UVOT 标配样品台加热功能,样品台高度可调。

## CIF 臭氧中和器

CIF 臭氧中和器 (UVO-N) 用于紫外臭氧清洗机臭氧去除配套设备。主要是通过纳米级金属氧化物催化剂分解臭氧，以及利用臭氧的不稳定性加速臭氧快速流动从而达到快速去除臭氧的目的。



### ● 产品特点

- ◆ 采用无毒、不燃烧、活性高、寿命长的纳米级金属氧化物的臭氧分解催化剂，能在室温状态下将高浓度的臭氧快速分解为氧气。
- ◆ 采用大流量、高负压、低噪音无刷隔膜泵加速臭氧流动，使得臭氧分解更完全。
- ◆ HEPA 高效过滤器应用，有效保护隔膜泵不被催化剂损伤。

### ● 技术参数

- ◆ 臭氧分解催化剂分解效率大于 99%。
- ◆ 隔膜泵抽气效率：10L/min。
- ◆ 电源：220V/50/60Hz/20W。
- ◆ 整机尺寸：280(W)×168(D)×180 (H) mm。

## CIF 匀胶机

CIF 匀胶机转速稳定、启动迅速，旋涂均匀，操作简单，结构紧凑实用，为实验室提供了理想的解决方案。广泛应用于微电子、半导体、新能源、化工材料、生物材料、光学，硅片、载玻片，晶片，基片，ITO 导电玻璃等工艺制版表面涂覆等。



### ● 产品特点

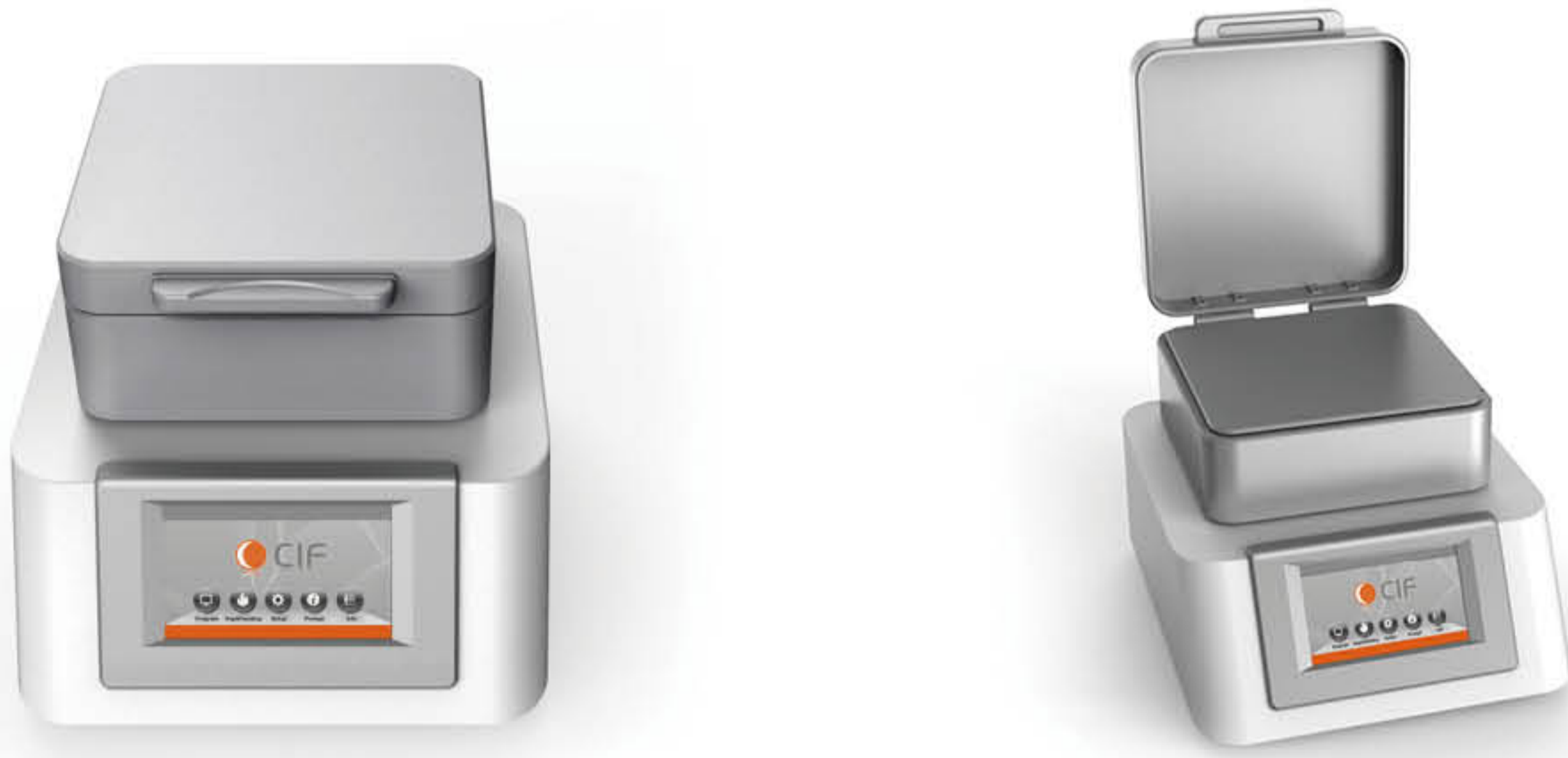
- ◆ 采用闭环控制伺服电机，数字式增速信号反馈，速匀准确，寿命长，保证匀胶均匀。
- ◆ 5寸全彩触摸屏，智能程序化可编程操控显示，标配10个匀胶梯度阶段(速度和时间梯度设置)，可选配10个可编程程序，每个程序下可设置10个匀胶梯度阶段，最多100个阶段。
- ◆ 内置水平校准装置，最大限度的保证旋涂均匀，可对大小不同规格的基片进行旋涂。
- ◆ 多重安全保护
  - 电磁安全开关，盖子打开卡盘停止，保证安全；**
  - 盖子自锁功能，防止飞片盖子弹开伤人；**
  - 双重安全上盖，聚四氟嵌镶钢化玻璃，避免单一玻璃或者亚克力上盖飞片伤人，最大限度保证实验人员安全。
- ◆ 样品托盘卡口和样品托盘之间三重密封安全保护，有效降低电机进胶的风险。
- ◆ 一机两用，根据不同样品可选真空吸盘和非真空卡盘两种旋涂方式。
- ◆ 符合人体功能学的水平取放样品旋涂托盘设计，取放样品更方便。
- ◆ 不锈钢喷塑涂层旋涂壳体，旋涂腔体采用 PTFE 材料。旋涂托盘采用聚丙烯 (NPP-H) 材料，耐酸碱防腐蚀，保证仪器在苛刻条件下仍能正常运行。
- ◆ 上下双腔体设计，较大的上腔体便于擦拭去除胶液，锥形下腔体结构设计便于收集胶液，并带废胶收集装置
- ◆ 可选氮气吹干、氮气保护，自动滴胶或简易滴胶装置，提供更多的操作便利性。
- ◆ 适用硅片、玻璃、石英、金属、GaAs, GaN, InP 等多种材料。

### ● 技术参数

型号	转速 (转/分)	转速稳定度	匀胶时间	旋涂基片尺寸 mm	外型尺寸 (LxWxH) mm
SC1	50-10000	±1%	0-2000S	圆片 Φ5-100, 方片最大 100x100	335x256x210
SC2	50-10000	±1%	0-2000S	圆片 Φ5-150, 方片最大 150x150	375x295x220

## CIF 烤胶机

CIF 烤胶机采用智能程序化控温技术，**控温精准均匀，加热快速高效，维修简单方便**，控温范围在室温 - 360°C之间，控温精度达到 0.1°C。适用于各种控温精度高，加热均匀性要求高的实验室。



### ● 产品特点

- ◆ 5 寸全彩触摸屏智能程序化温度控制系统，中英文互动操作界面。
- ◆ 控温精准，加热快速高效，控温精度达到 0.1°C。
- ◆ 加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置。  
存储 10 种方法，并可编辑，每种方法可设定 10 个温度梯度段，可实现 100 段程序控制。
- ◆ 实时程序状态显示，实时工作曲线图形显示。
- ◆ 温度可校准，保证了控温的准确性。
- ◆ 延时启动、定时预约启动功能。
- ◆ 过温自动断电保护。
- ◆ 加热完成自动停止，无须工作人员值守。
- ◆ 镶嵌式加热系统，维修简单方便。
- ◆ 材质：加热面采用硬质阳极氧化铝加热面板，壳体不锈钢喷塑。

### ● 技术参数

型号	控温范围°C	控温精度°C	功率 kw	工作尺寸 mm	外型尺寸 (LxWxH) mm
PH25	RT-360	±0.1	1.8	220x220	335x270x210
PH35	RT-360	±0.1	2.4	350x350	450x400x210





■  
CIF USA  
赛福国际集团有限公司  
CIF INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

地址：美国加利福尼亚州阿罕布拉市506北加菲尔德大街210号  
506 N GARFIELD AVE#210,ALHAMBRA CA

■  
CIF CHINA  
华仪行（北京）科技有限公司  
电话：010-63752026  
传真：010-63752028  
邮箱：INFO@CIF-CHINA.COM  
网址：WWW.CIF-CHINA.COM  
地址：北京市丰台区科兴路7号国际企业孵化中心301室

赛福仪器承德有限公司  
电话：0314-5703666,5703555  
邮箱：INFO@CIF-CHINA.COM  
网址：WWW.CIF-CHINA.CN  
地址：河北省承德市平泉市南五十家子镇通航路6号

全国销售服务热线：400-6505-735

